

## B-5

$(\text{Pb}_{0.4}\text{Ca}_{0.6})[(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})_{1-x}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_x]\text{O}_3$ 계 세라믹스의 마이크로파 유전특성

Microwave Dielectric Properties of  $(\text{Pb}_{0.4}\text{Ca}_{0.6})[(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})_{1-x}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_x]\text{O}_3$  Ceramics

김응수, 한기문, 이형규\*, 윤기현\*\*

경기대학교 재료공학과

\*전자부품연구원

\*\*연세대학교 세라믹공학과

$(\text{Pb},\text{Ca})[(\text{Me},\text{Nb})\text{O}_3]$ 계는 우수한 마이크로파 유전특성을 갖고 있으나, 소자로서 응용화를 위해서는 공진 주파수의 온도계수(TCF) 제어가 필요하다 따라서 TCF변화 원인을 규명하고, 예측하려는 다양한 연구가 진행되어 왔다 본 연구에서는 columbite법에 의한  $(\text{Pb}_{0.4}\text{Ca}_{0.6})[(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})_{1-x}(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})_x]\text{O}_3$  (PCFMN) 세라믹스의  $(\text{Fe}_{1/2}\text{Nb}_{1/2})^{4+}$  자리에  $(\text{Mg}_{1/3}\text{Nb}_{2/3})^{4+}$ 를 치환함으로 B-자리 결합원자가 변화에 따른 TCF안정화 및 마이크로파 유전특성의 변화를 고찰하였다. PCFMN 세라믹스는 전 조성( $0.1 \leq x \leq 0.8$ )에서 안정된 cubic 페롭스카이트상을 얻을 수 있었으며,  $x=0.1$  mol에서  $0.8$  mol 치환량 증가에 따라 TCF는 B-자리 결합원자 가의 감소에 기인하여  $-11 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 에서  $-25 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 로 증가되었다. 유전상수(K)는 이온 분극률에 의존하였고, 품질계수(Qf)는 미세구조 변화에 의존하였다  $x=0.4$ 에서  $1250^\circ\text{C}$  3시간 소결시  $K=73.56$ ,  $Qf=5,074 \text{ GHz}$  그리고  $\text{TCF} = -6 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ 의 마이크로파 유전특성을 얻을 수 있었다

## B-6

SILC(Stress Induced Leakage Current)를 이용한 하프늄산화막-알루미나( $\text{HfO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$ ) 적층 유전박막의 전기적 신뢰성 실험

The Reliability Test using SILC of Gate Dielectrics Made of  $\text{HfO}_2-\text{Al}_2\text{O}_3$  Multilayers

최지훈, 이치훈, 조문주, 황철성, 김형준

서울대학교 재료공학부

최근 전자재료분야 중 고집적 소자를 다루는 분야에서는 산화규소 유전박막의 두께가 얇아짐에 따라 상부전극과 하부기판 사이에서 발생하는 누설전류가 큰 문제가 되었다 따라서 이를 극복하기 위해 고유 전상수를 가진 두꺼운 유전박막을 사용하기 시작하였는데, 그 중 대표적인 것이 하프늄옥사이드( $\text{HfO}_2$ )와 알루미나( $\text{Al}_2\text{O}_3$ )이다

본 연구에서는 하프늄옥사이드와 알루미나를 이용하여 하프늄산화막, 하프늄산화막/알루미나, 알루미나/하프늄산화막/알루미나 세 종류의 유전막을 가진 소자를 제작하여 수소가스열처리 과정에서 온도와 시간에 따른 I-V 특성과 C-V 특성을 살펴보았으며, 일정한 전기적 응력을 가했을 때 변화하는 누설전류의 양으로써 장기적인 신뢰성을 관찰해보았다

소자제작을 모두 마친 후 시행한 수소가스 열처리의 온도와 시간에 따라 I-V 특성과 C-V특성의 차이를 확인하였다 그리고 수소가스 열처리의 온도와 시간에 따라 일정한 전기적 스트레스를 가한 후 보이는 누설전류의 양의 차이를 확인하였다 또한 유전막의 종류에 따라서 각기 다른 전기적 특성을 보였다